

## 代替フロン等3ガス排出量の推計について

温室効果ガス別	基準年 (1995年)	→	現状対策ケース (2010年前後) <sup>註</sup>		⇒	対策強化ケース (2010年前後) <sup>註</sup>		大綱の目標
	万t-CO <sub>2</sub>		万t-CO <sub>2</sub>	基準年 総排出量比		万t-CO <sub>2</sub>	基準年 総排出量比	
HFC	2,023	→	4,642	+2.1%	⇒	3,494	+1.2%	
PFC	1,259	→	870	-0.3%	⇒	870	-0.3%	
SF6	1,692	→	1,215	-0.4%	⇒	803	-0.7%	
代替フロン等3ガス合計	4,974	→	6,727	+1.4%	⇒	5,167	+0.2%	7,448 +2%

(註)2008年～2012年推計値の5年間の平均

### HFC等3ガスの排出量の推計値

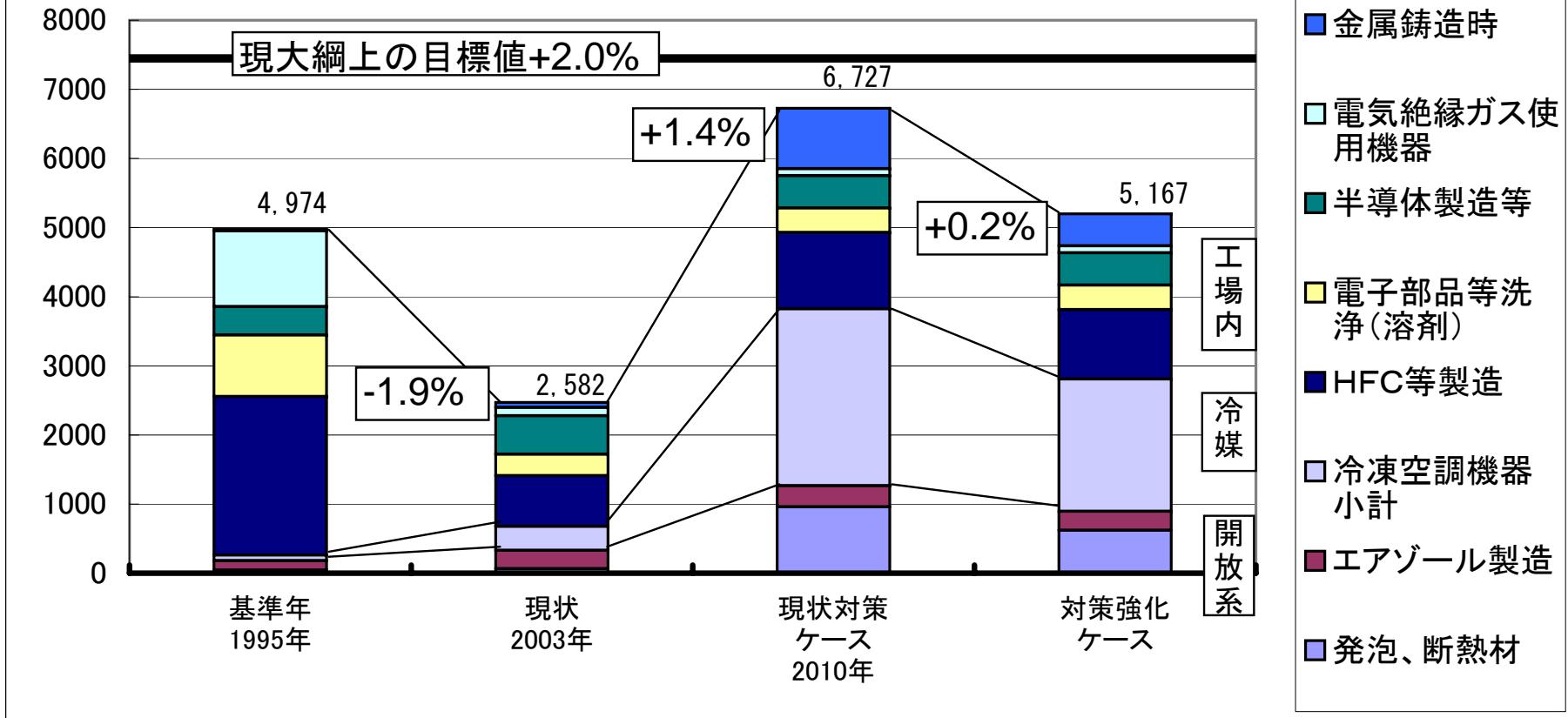
(単位 : 万t-CO<sub>2</sub>)

ガス種	1995年 基準年	2003年 現状	2010年		削減量
			現状対策 ケース	対策強化 ケース	
開放系小計		182	332	1,266	894 372
発泡、断熱材	HFC	46	65	959	619 340
エアゾール製造	HFC	137	267	307	275 32
冷凍空調機器小計		81	346	2,610	1,933 676
カーエアコン	HFC	79	282	502	311 191
家庭用エアコン	HFC	0	9	95	95
業務用冷凍空調機器	HFC	1	39	919	630 289
家庭用冷蔵庫	HFC	1	16	17	17
補充用冷媒（業冷及びカーエアコン）	HFC			1,077	880 196
製造工程（工場内）小計		4,711	1,904	2,852	2,340 512
HFC等製造	小計	2,293	733	1,103	1,003
副生物HFC-23	HFC	1,697	507	671	577 94
HFC製造時	HFC	49	44	81	75 6
PFC製造時	PFC	76	102	226	226
SF6製造時	SF6	471	81	124	124
電子部品等洗浄（溶剤）	PFC	890	421	356	356
半導体製造等	小計	410	554	466	466
	HFC	15	11	13	13
	PFC	286	371	286	286
	SF6	110	172	167	167
電気絶縁ガス使用機器	SF6	1,099	120	103	103
金属鋳造時	小計	19	76	824	412 412
	PFC	7	2	2	2
	SF6	12	74	822	410 412
合計		4,974	2,582	6,727	5,167 1,560
基準年総排出量とそれに対する増減割合		123,695	-1.9%	1.4%	0.2%

ガス別排出量	HFC	2,023	1,240	4,642	3,494	1,148
	PFC	1,259	895	870	870	0
	SF6	1,692	447	1,215	803	412

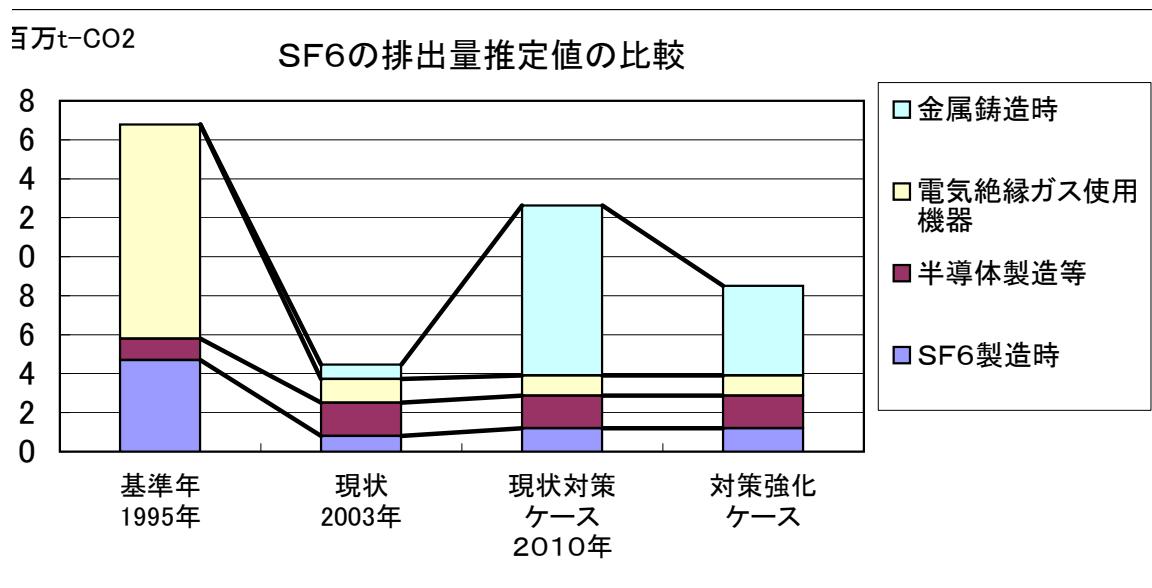
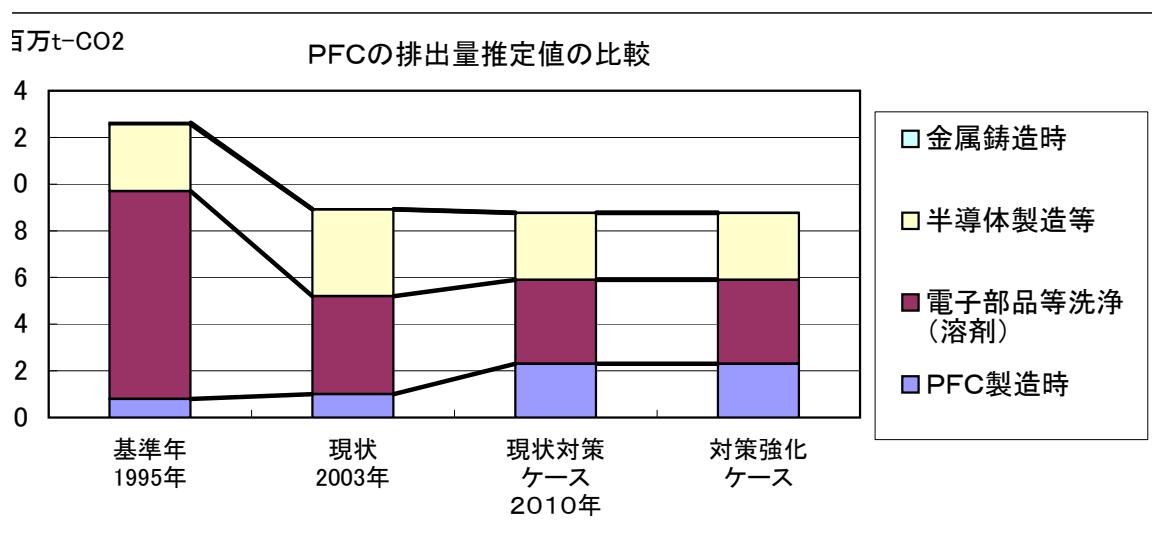
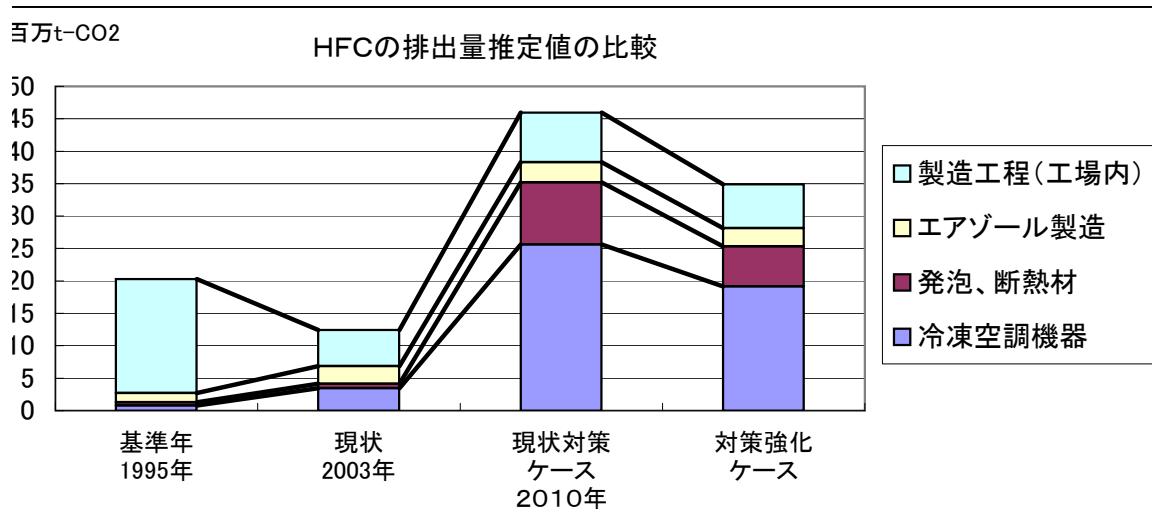
万t-CO<sub>2</sub>

## HFC等3ガスの排出量の推計値

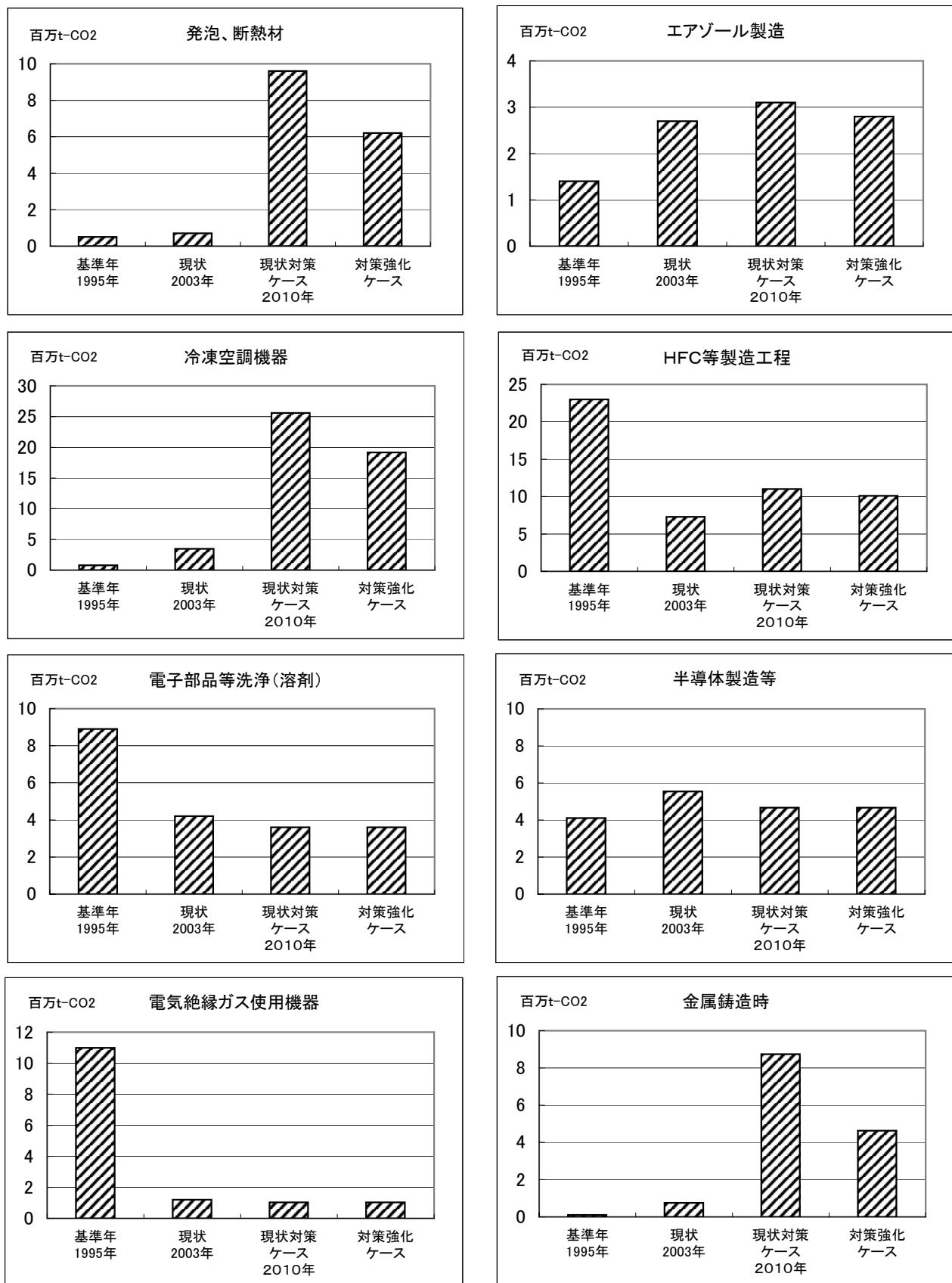


注) 「開放系」=エアゾール製造、発泡・断熱材 「冷媒」=冷凍空調機器 「工場内」=その他  
%は6ガスの総排出量に対する「当該年の排出量-基準年の排出量」の割合

## フロン等3ガスのガス別の排出量推計比較



## フロン等3ガスの業種区分毎の排出量推計の比較



### フロン等3ガスの業種区分毎の排出量推計の比較(同じ目盛り)

